

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

и рекомендации по обработке

Фоторезист **First FT-3638A**

Производство - Китай.

**FT-3638A** является полным аналогом **Riston 215**.

Это высококачественный сухой пленочный фоторезист водощелочного проявления, применяемый при изготовлении печатных плат. Он совместим с процессами гальванического меднения, оловянирования, нанесения покрытия олово/свинец, травления.

## **Характеристика продукта.**

Сухой негативный пленочный фоторезист.

Предназначен для получения тонких линий изображения.

Неэкспонированный цвет при желтом свете: **сине-зеленый**

Проявленное изображение: **четкое**

## **Преимущества фоторезиста FT-3638A:**

Отличная адгезия.

Высокое разрешение.

Широкий диапазон технологических параметров.

Отличная перекрываемость отверстий диаметром более 6 мм.

Яркий цвет, чёткость изображения до и после экспонирования.

Низкий уровень осадка и пенообразования для легкого обслуживания.

## **Размеры фоторезиста:**

Толщина фотослоя: 38 мкм,

Ширина рулона: 304 мм и 610 мм (Иная ширина рулонов поставляется по запросу).

Минимальный заказ — 1 коробка (2 рулона).

## **Результаты тестирования.**

Шкала Штouффера (41 ступень)	FT-3638A
Мощность засветки под шаблоном, мДж/см <sup>2</sup>	28 (20-40)
Концентрация раствора проявления Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , %	0,8-1,2
Температура проявления	30±2
Минимальное время проявления, с	20
Концентрация раствора снятия, NaOH, %	3,0±1,0
Температура снятия, °C	50±5
Минимальное время снятия, с	42
Разрешение, мкм	20/41 СТ 23/41 СТ 26/41 СТ
	35 40 45

## **Подготовка поверхности заготовок.**

Для улучшения адгезии фоторезиста к медной поверхности рекомендуется произвести тщательную подготовку поверхности.

Существует несколько методов подготовки поверхности:

Механический (пенза или щетками на установке).

Химический (кислотный очиститель).

Микротравление. Предпочтительнее, микротравление.

## **Операции очистки микротравлением.**

Кислотная ванна очистки: >35°C - 2-3 мин.

Струйная промывка: 1-2 мин.

Микротравление: для получения шероховатости 0,15-0,26 мкм меди

Состав для микротравления: персульфат натрия и 1% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> при T= 20-25°C.

Струйная промывка: 1-2 мин.

Подтравливание в сернокислотной ванне (5-10%): 1-2 мин.

Струйная промывка 1-2 мин.

## **Промывка**

Двуступенчатая, проточная вода.

Температура промывки: 20-25°C.

Время промывки ≥1 мин.

Значения режимов подготовки поверхности, приводимые в данной рекомендации, получены на определенном производственном оборудовании и предлагаются лишь в качестве ориентировочных значений для производственного процесса. Реальные параметры технологии обработки будут зависеть от применяемого оборудования и их необходимо определять для каждого конкретного производства.

## **Ламинарирование.**

Перед нанесением фоторезиста заготовки необходимо предварительно нагреть,

Температура 40-60°C.

Время предварительного нагрева подложки не должно быть слишком большим, а температура -слишком высокой, иначе это может привести к окислению фотослоя.

## **Режимы ламинарирования:**

Температура: 110°C.

Давление: 4 кг/см<sup>2</sup>.

Скорость: 1,5-3,0 м/мин.

## **Время хранения после ламинарирования.**

Экспонирование можно проводить сразу же после ламинарирования, но лучше выдержать заготовки при комнатной температуре не менее 15 минут.

Максимальная продолжительность хранения заготовок после нанесения фоторезиста до экспонирования (рекомендации): до 3 дней.

## **Хранение экспонированных заготовок.**

Предпочтительно: в вертикальных кассетах, нежелательна горизонтальная укладка заготовок.

## **Экспонирование.**

Воспроизведимость линий будет зависеть от того, на каком оборудовании проводится экспонирование и должна определяться для каждой конкретной установки.

## **Проявление.**

Карбонат натрия, безводный (кальцинированная сода) Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

Рабочий раствор: 0,8 - 1,2 %

Концентрация Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>: 8,0 – 12,0 г/л \*

Карбонат натрия Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>\*H<sub>2</sub>O.

Рабочий раствор: 1,0 – 1,1 %

Температура: 30°C

Давление распыления: 2.0 кг/см<sup>2</sup>

## **Пеногасители.**

FT-3638A может обходиться и без применения пеногасителей. Потребность в пеногасителях зависит от качества воды, чистоты реагентов, загрязнения раствора фоторезистом, конструкции оборудования и конкретных условий производства. Предварительно их нужно проверить на совместимость с материалом. При циклическом технологическом режиме добавлять пеногаситель при составлении ванны.

При наличии автоматической системы проявления добавлять пеногаситель непосредственно в ванну в зону высокой турбулентности. Не добавлять пеногаситель в расходный бак или в корректирующий раствор!

## **Режимы промывки и сушки.**

Промывочная вода.

Предпочтительнее использовать жесткую воду (150-250 мг-экв/л CaCO<sub>3</sub>).

Температура промывки: 15-25°C

Давление воды: 1.4-2.4 бара.

Сушка: тщательная обдувка воздухом. Предпочтительно горячим.

Слив отработанный проявитель, когда показатель pH достигнет значения 10,2.

## **Время хранения после проявления до металлизации:**

Рекомендуется: 0 - 3 дня.

Примечание: Во избежание развития хрупкости пленки рекомендуется свести к минимуму засветку проявленного фоторезиста белым светом.

## **Уход за проявителем**

Рекомендуется 1 раз в неделю очищать проявитель от осадка фоторезиста, углекислого каль-ция, пеногасителя.

### **Очистка оборудования.**

Залить в ванну 5% раствор KOH или NaOH. Нагреть до температуры 55°C, включить установку на 30–90 мин., чтобы растворить частицы фоторезиста. Затем слить раствор и промыть установку чистой водой в течение 30 мин.

При необходимости повторить очистку оборудования от осадка.

Остатки синего красителя на оборудовании рекомендуется удалять в 5%-ном растворе HCl при температуре 55°C в течение 30 мин.

### **Удаление фоторезиста.**

Температура – 50°C,  
Концентрация NaOH 3.0 %.

### **Руководство по процессу обработки.**

(чистая комната; температура – 20 - 22°C; относительная влажность – 50 ± 10%)

Процесс		Рекомендации	
Нанесение	Температура валка, °C	110 ± 10	Температура на выходе 50 ± 10 °C
	Скорость, м/мин	2.0 ± 1.0	
	Давление валка, кг/см <sup>2</sup>	3.5 ± 1.5	
Время выдержки	Время, мин	15 мин – 8 часов	В желтом свете
Экспонирование	Энергия, мДж/см <sup>2</sup>	Шаг выдержки 20 - 26 по шкале Штоуффера	Без шаблона
Время выдержки	Время, мин	15 мин – 24 часа	В желтом свете
Проявление	Химическое Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , %	1.0 ± 0.2	
	Температура, °C	30 ± 2	
	Точка проявления, %	45 - 55	
	Давление распыления, кг/см <sup>2</sup>	2.0 ± 0.5	
Снятие	Химическое NaOH, %	3.0 ± 1.0	
	Температура, °C	45 - 55	
	Точка снятия, %	50 - 60	

### **Условия хранения:**

Пленку следует хранить в нераскрытой оригинальной упаковке на стеллажах в вентилируемом помещении при условиях:

- температура (T): 5 -20°C
- относительная влажность (RH): не менее 60%.

Стеллажи должны находиться на расстоянии не менее метра от отопительных приборов и не менее 0,1 метра от пола. В помещение, где хранится фотоматериал, не должны проникать вредные газы, сероводород, ацетилен, аммиак, окислы азота, пары ртути и т.п.

Срок годности FT-3638A при соблюдении этих условий составляет: 90 дней (с даты изготовления).

Перед использованием фоторезист должен пройти акклиматизацию на производственном участке при температуре 21±3°C и относительной влажности 50±10%.

### **Меры предосторожности.**

Поскольку сухая пленка содержит мономеры акрилата, она может раздражать кожу и вызывать кожную аллергию.

Это требует применения защитных мер:

- Не контактировать непосредственно с сухим пленочным фотослоем, надевать защитные перчатки перед работой.
- Если фоторезист попадет в глаза, немедленно промыть их водой и обратиться к врачу для обследования.

Поскольку проявитель и раствор удаления фоторезиста являются щелочными растворами, а травильный раствор – кислым, прямой контакт с ними невозможен, поэтому при ремонте и эксплуатации оборудования необходимо принимать защитные меры и надевать защитные очки и перчатки.

Сухой пленочный продукт сине-зеленого цвета. При длительном времени хранения цвет сухой пленки может частично выцвести, но это не влияет на его использование.